(11)Publication number:

08-015318

(43)Date of publication of application: 19.01.1996

(51)Int.CI.

G01R 1/073 G01R 31/28 H01L 21/66

(21)Application number: 06-164701

(71)Applicant :

YAMAICHI ELECTRON CO LTD

KYUSHU NITTO SEIKO KK

NITTO KOSHIN KK

(22)Date of filing:

23.06.1994

(72)Inventor:

SUZUKI NOBUSHI

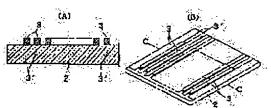
OKUNO TOSHIO HITOMI YASUYUKI

(54) PROBE UNIT AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a probe unit provided with resilient contact pieces by projecting the end part of a lead group arranged at a fine pitch on the surface of a base board from the base board in which the lead group can be formed soundly and easily without requiring the work for bonding the lead group to the base board.

CONSTITUTION: A large number of leads 3 are grown by plating on the surface of a base board 2 and a resilient contact piece 3a is formed at one end of the lead 3 projected from one end of the base board 2. First and second base boards are then abutted each other on the end faces thereof and a large number of leads are grown by plating on the surface of the first and second base boards while traversing both base boards and being arranged side by side. Finally, the second base board is stripped and the lead terminals extending on the second base board are projected from the end part of the first base board.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.06.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2599895

[Date of registration]

09.01.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

		-		
		-		
		- 4		
	4			
•				

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-15318

(43)公開日 平成8年(1996)1月19日

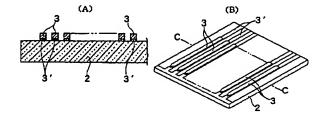
(51) Int.Cl.		識別記号		庁内整理番号	FI	[•	i	支術表	示箇所
G 0 1 R	1/073 31/28	1	D									
H01L	•	:	В	7514-4M	G	0 1 R	31/ 28			K		
						審査請	求有	請求項	質の数3	FD	(全 8	3 頁)
(21)出願番号	+	特顯平6-164701	1		(71)	人類出						
(00) (USS E1		平成6年(1994)	6 2 2	20				機株式会	会社 中馬込3~	T E 202 #	47 县	
(22) 出顧日		平成6 年(1994)(0 73 2		(71)	上頭人			- MUX 3	1 11 20 1	a ()	
					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ш		東精工杉	大式会社			
									多区半过	首橋 17	「目6番	46号
					(71)	人鄭出	594050	371				
							日東公	進株式会	ὰ			
							京都府	綾部市井	 倉新町	≸8田Д	神の1	_
					(72)	発明者	鈴木	悦四				
							東京都	大田区中	馬込3	「目28者	\$7号	<u>ш</u> —
							電機株	式会社内	4			
					(74)	代理人	弁理士	中畑	孝			
										摃	終質に	こ続く

(54) 【発明の名称】 プロープユニットとその製法

(57)【要約】

【目的】この発明はベース板2の表面に微小ピッチで並列配置したリード群の端部をベース板から突出させて弾性接片を形成したプローブユニットにおいて、リード群をベース板に接着する作業等を要せずに健全且つ容易に形成できるようにしたものである。

【構成】ベース板2の表面に並列してメッキ成長により形成された多数のリード3を有し、該メッキ成長リード3の一端を上記ベース板2の一端から突出させて弾性接片3aを形成したプローブユニット。第1ベース板と第2ベース板とを端面において突き合せ、第1、第2ベース板の表面に両ベース板を横断せる多数のリードを並列状態でメッキ成長させ、第2ベース板を剥離して第2ベース板上に延在していたリード端部を上記第1ベース板の端部から突出させるブローブユニットの製法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ベース板の表面に並列してメッキ成長によ り形成された多数のリードを有し、該メッキ成長リード の一端を上記ベース板の一端から突出させて弾性接片を 形成したことを特徴とするプローブユニット。

【請求項2】第1ベース板と第2ベース板とを端面にお いて突き合せ、第1, 第2ベース板の表面に両ベース板 を横断せる多数のリードを並列状態でメッキ成長させ、 第2ベース板を剥離して第2ベース板上に延在していた リード端部を上記第1ベース板の端部から突出させると 10 とを特徴とするプローブユニットの製法。

【請求項3】ベース板表面に多数のリードをメッキによ り並列状態で成長させ、該ベース板の端部を切除して該 ベース板切除部上に延在していたリード端部を残余のベ ース板の端部から突出させることを特徴とするプローブ ユニットの製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は液晶パネルの検査等に 使用されるプローブユニットの如き、リードを微小ピッ 20 チで並列配置し弾性接片を付有せねばならない場合に適 したプローブユニットとその製法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶パネルを形成するガラス板端縁に並 列配置される電極層は益々微小ピッチ化する傾向にあ り、これら液晶パネルの検査においては、検査装置側に おいて、これら微小ピッチの電極層に対応するピッチの プロープユニットの提供が必要となる。

【0003】現状では上記電極層のピッチは0.1mm 以下であり、これら液晶パネルの電極層に接触する検査 30 側のプローブユニットのリードをフーブ材から機械的に 打抜加工して形成することは困難となってきている。

【0004】従って現在はエッチング法や、マスクを通 して光照射して形成された蝕刻溝に金属材を充填するア ディティブ法等を使用して微小ピッチのリード群を形成 する方法が採られている。この方法を使用した最新の技 術が特願平4-297578号及び特願平4-3828 9号である。

【0005】との先行発明は何れもエッチング法等によ って形成されたリード群をガラス板等の絶縁ベース板の 40 表面に全巾に亘り接着剤を介して接着し、各リードの一 端側を絶縁ベース板の端部から突出しこの突出部先端を 上記液晶パネルの電極層との加圧接触に供すると共に、 絶縁ベース板の表面に接着された各リードの基端側表面 に検査装置側のIC等のリードを重ねて接続する構成と している。

[0006]

【発明が解決しようとする問題点】上記先行発明は絶縁 ベース板にリード群の各リードピッチを正確に保ちなが ら接着剤で固定しなければならない。しかし接着剤の収 50 問題を惹起せず、接着剤塗布や接着作業の困難性、或い

縮、特に熱収縮で、各リードピッチは変化する。ごれを 防ぐため、圧接力を加えながら各リードを接着するが、 この場合も圧接力によりリードピッチが変化する。又接 着剤が毛細管現象により絶縁ベース板の端部から延出し たリード部に流出して、上記の接着剤の収縮によりリー ド先端ピッチにバラツキが出る欠点がある。

[0007]

【問題点を解決するための手段】との発明は上記問題点 を有効に解決する構成を持ったプローブユニット及びそ の製法を提供するものであり、このプローブユニットは ベース板表面に並列配置せるリード群がメッキ成長によ り形成されてベース板に固定されており、同時にこのメ ッキ成長により形成したリードにより上記ベース板端部 から突出せる弾性接片を得ている。

【0008】上記プローブユニットは次に述べる方法に よって製造される。

【0009】第1の方法は第1ベース板と第2ベース板 とを端面において突き合せ、この突き合せ面は接着する か又は自由接触面とする。次でこの第1. 第2ベース板 の表面に多数のリードを両ベース板を横断するように並 列状態でメッキ成長させる。次で第2ベース板を第2ベ ース板上に延在していたリード端部から剥離してこのリ ード端部を上記第1ベース板の端部から突出させるよう にしてプローブユニットを製造する思想を提供してい

【0010】又第2の方法はベース板表面に多数のリー ドを並列状態でメッキ成長させ、次で該ベース板の端部 を切除してベース板切除部上に延在していたリード端部 を残余のベース板の端部から突出させプローブユニット を製造する思想を提供している。

【0011】上記ベース板の表面にリード群をメッキ成 長させる下地として、上記リードと同一ピッチの細長導 電層を事前に印刷等により形成して置き、この各細長導 電層を電極としてその表面に直接メッキ成長を促し所定 厚みを有するリードを形成する。

【0012】従ってこの場合、プローブユニットはベー ス板表面に密着して並列配置されたメッキ成長下地層た る多数の細長導電層を有し、この各細長導電層を下地と してメッキ成長により形成した多数のリードを有し、こ のメッキ成長リードによってベース板一端から突出せる 弾性接片を得ている。

[0013]

【作用】以上のように、この発明に係るプローブユニッ トはベース板表面にメッキ成長により形成された並列リ ード群を有し、このリード群により形成されたベース板 より突出せる並列弾性接片群を有する。

【0014】従ってエッチング法等により形成したリー ド群を準備し、これを接着剤によりベース板表面に接着 する場合のような、接着剤の収縮によるピッチ変化等の

は接着するまでの整列を保持するタイパー等のリード間 連結手段を要せず、従ってこのタイパーを爾後的に切断 する困難な作業も排除できる。

【0015】又メッキ成長によりリード群を極小ピッチ に髙精度に形成でき、弾性接片の弾性と強度に必要な厚 みも充分に確保できる。

[0016]

【実施例】図2乃至図9は本発明の第1実施例である。 図2A,Bに示すように、ガラス板,合成樹脂板,セラ ミック板等の絶縁板から成るベース板2の表面に予定す 10 るリード3のピッチと同じピッチのストライプ状のパタ ーンを持つ(並列配置した)細長導電層3′を形成す

【0017】この細長導電層3′はベース板2に金属膜 を成膜した後これをホトエッチングプロセスでパターニ ングする方法や導電ペーストを印刷する方法等の既知の プリント配線基板におけるバターン製造法の適用により 容易に形成できる。

【0018】これら既知の方法で並列細長導電層3′を ベース板2の表面に並列配置にして形成し、その表面に 20 前記リード3群、及び弾性接片3a群をメッキ成長して 形成するのである。

【0019】上記細長導電層3′は図2に示すように、 一端延在部 b においてはメッキによりリード3を形成し た時、リード3即ちメッキ層が充分な強度で細長導電層 3′と母材結合する金属(例えば銅材)が選ばれてお り、同他端延在部分aはメッキ形成できる金属であって なお且つ比較的弱い剥離力でメッキ成長層即ちリード3 から剥離できる金属(又は剥離性の表面層を有する金 属)を以って形成されている。例えばこのような剥離性 30 を有する金属として極く薄いクロム材を銅材上に成膜す る方法あるいはニッケル膜を成膜する方法が採られる。 【0020】具体例として図2に示すように、ベース板 2の表面に銅材から成る細長導電層3′を並列して形成 し、この細長導電層3′の一端延在部分aの表面に例え ばクロム材の如き細長剥離層8を形成する。この剥離層 8を形成した a 部分は弾性接片 3 a が形成される部分で ある。換言するとaはリード3の弾性接片形成区域であ るのに対しbはリード3の結合片形成区域である。

【0021】図3に示すように、上記図2の如くしたべ 40 ース板2の表面を感光性樹脂層9 (レジスト層)で覆 う。例えば感光性樹脂フィルムを貼り合わせるか、又は 感光性樹脂材を塗布する。

【0022】次に図4A、Bに示すように、上記感光性 樹脂層9の表面に露光マスク10を重ね、光11を上方 から照射することにより感光性樹脂層9を露光する。露 光マスク10は図4日に示すように、リード3と同一パ ターンの透光部10a(感光性樹脂層9がネガレジスト である場合、10aは逆にリード3と同一パターンの非 細長導電閥3′とが対応するように上記マスク10を設 置し上記露光を行なう。

【0023】次に図5A、Bに示すように、現像により 透光部 (ネガレジストの場合は非透光部) 10 a に対応 した感光性樹脂層9の露光樹脂(ネガレジストの場合は 非露光樹脂)を除去して感光性樹脂層9を貫通するリー ド形成用溝(メッキ成長用溝)9 a を形成し、細長導電 層3′をこの溝9aと対向する部分において露出する。 上記リード形成用溝9aは当然リード3と同じピッチで 並列配置されている。

【0024】而して図6に示すように、図5の状態にし たものを適当なメッキ液により電気メッキし、上記リー ド形成用溝9a内におけるメッキ成長を促す。即ち、電 気メッキによりリード形成用溝9 aの底面に露出してい る細長導電層3′(メッキ成長下地)の表面に直接メッ キが施され溝9a内における成長が促されて、溝9aの 深さと略同じ厚みのリード3を生成する。

【0025】上記メッキ金属としては適当な硬さと弾性 を持つもの、例えばニッケル又はニッケル合金であり、 メッキ成長下地たる細長導電層3′のb部を銅又は銅合 金で形成することにより上記ニッケル又はニッケル合金 とは極めて強固に結合し、細長導電層3°のa部で剥離 性のある金属8によりある程度の強度で結合する。

【0026】次に図7A、Bに示すように感光性樹脂層 9を除去すると、上記メッキ成長により形成されたリー ド3が等間隔をおいて並列されたベース板が得られる。 【0027】次に、図8に示すようにベース板2の一端 部を切り込み12から所要の長さに亘りリードから剥離 しつつ切除する。

【0028】この結果図9A、Bに示すようにリード3 はその結合片3bによって残余のベース板2の表面に強 固に結合すると共にベース板切除部上に延在していたリ ード部分は残余のベース板2の一端から側方へ遊離し突 出したプローブユニットが形成される。このリード突出 部で前記弾性接片3 a を形成する。

【0029】上記ベース板2の一端を切除するに際して のリード3からの剥離を容易にする例として、前記細長 導電層3′における弾性接片形成区域aの表面に剥離層 8を形成したものである。従ってこの剥離層8の内端縁 付近から上記ベース板端部を切除することによってリー ド3からの剥離が比較的容易に行なえる。

【0030】上記ベース板端部は剥離層8とリード3の 界面から剥離しつつ除去され、従って細長導電層3°は この剥離層8を形成した部分において切除したベース板 端部に付着した状態で除去される。

【0031】換雪すると図9に示すように、リード3は ベース板2との結合片3bにおいてメッキ成長下地たる 細長導電層3′を介して上記ベース板2に固定され、と のベース板2から突出する弾性接片3aの裏面には細長 透光部)を有し、この透光部10a(又は非透光部)と 50 導電層3′が残窟しない構造となる。

【0032】図9に示すように、上記リード3は上記細長導電層3′の一端延在部の表面においてメッキ成長させ、他端延在部をベース板2の表面に露出させてIC等との接続に供する電極端子3a′を形成する。

【0033】換言するとメッキ成長にて形成されたリード3は細長導電層3′の一端延在部の表面に結合片3bにより結合され、且つこの細長導電層3′の一端延在部を介してベース板2に結合された構造となり、このリード結合片3bの後端から後方へ細長導電層3′の他端延在部が導出して露出され電極端子3a′を形成している。

【0034】図示しないが、本発明は細長導電層3'の全長に亘ってメッキ成長によるリード3を形成する場合も含む。この場合リード3の結合片端部にて上記電極端子3a'を形成する。

【0035】次に、この発明の第2実施例について説明する。

【0036】との実施例は図10に示すように、第1ベース板2Aと第2ベース板2Bとを端面において突き合せ、第1、第2ベース板2A、2Bの表面に両ベース板 20を横断せる多数のリード3を並列状態でメッキ成長させ、第2ベース板2Bを剥離して第2ベース板上に延在していたリード端部を上記第1ベース板2Aの端部から突出させるようにしたプローブユニット1の製法を開示している。

【0037】その具体例に付き図11乃至図17に基き 詳述すると、プローブユニット1の完成時においてリー ド担体となる第1ベース板2Aの他に、メッキ成長して リードを形成した後に除去される第2ベース板2Bを準 備する。

【0038】第1, 第2ベース板2A, 2Bはガラス板、合成樹脂板等の絶縁ベース板であり、両者ともに矩形を呈する。

【0039】図11A、Bに示すように第1ベース板2 Aの全表面に導電層3″をベタに積層する。

【 0 0 4 0 】との導電層 3 ″ は導電ペーストを印刷する 方法等の既知のプリント配線基板におけるバターン製造 法の適用により形成される。

【0041】上記導電層3″はメッキ成長によりリード 3を形成した時、リード3即ちメッキ層が充分な強度で 40 導電層3″と母材結合する金属(例えば銅材)で形成する。

【0042】他方第2ベース板2Bの全表面にはメッキ成長できる金属であってなお且つ比較的弱い剥離力でメッキ成長層即ちリード3から剥離できる金属(又は剥離性の表面層を有する金属)を以って剥離層8′をベタで層着する。

【0043】本発明は上記剥離層8′と導電層3″とを 予定するリード3のピッチと同一にし並列配置する場合 を含む。 【0044】例えば上記のような剥離層8′を形成する金属として極く薄いクロム材を第2ベース板2Bの表面に成膜する方法が採られる。上記第2ベース板2Bの表面に成膜された剥離層8′はリード3の弾性接片3aがメッキ成長される下地層を形成し、これに対し第1ベース板2Aの表面に成膜された導電層3″はリード3の結合片3bをメッキ成長させる下地層を形成する。

【0045】上記の如くした第1ベース板2Aと第2ベース板2Bを準備し、両ベース板2A、2Bを直線状の 端面において相互に突き合わせる。

【0046】この突き合せによって第1ベース板2Aの 導電層3″と剥離層8′とを突き合せ線cにおいて連続 状態にする。

【0047】上記第1ベース板2Aと第2ベース板2B とは突き合せ面において自由接触面とし治具によって突 き合せ状態を保持する。

【0048】又は両ベース板2A、2Bを突き合せ面に おいて接着剤を介し仮接着し突き合せ状態を保持する。 この接着は剥離を容易にする強度の弱接着である。

【0049】図12に示すように、上記図11の如くした第1,第2ベース板2A,2Bの表面を感光性樹脂層9(レジスト層)で覆う。例えば感光性樹脂フィルムを貼り合わせるか、又は感光性樹脂材を塗布する。

【0050】次に図13A、Bに示すように、上記感光性樹脂層9の表面に露光マスク10を重ね、光11を上方から照射することにより感光性樹脂層9を露光する。 露光マスク10は図13Bに示すように、リード3と同一パターンの透光部10a(感光性樹脂層9がネガレジストである場合、10aは逆にリード3と同一パターンの非透光部)を有する。

【0051】次に図14A、Bに示すように、現像により透光部(ネガレジストの場合は非透光部)10aに対応した感光性樹脂層9の露光樹脂(ネガレジストの場合は非露光樹脂)を除去して感光性樹脂層9を貫通するリード形成用溝(メッキ成長用溝)9aを形成し、導電層3″をこの溝9aと対向する部分において露出する。上記リード形成用溝9aは当然リード3と同じピッチで並列配置されている。

【0052】而して図15に示すように、図14の状態にしたものを適当なメッキ液により電気メッキし、上記リード形成用溝9a内におけるメッキ成長を促す。即ち、電気メッキによりリード形成用溝9aの底面に露出している導電層3"(メッキ成長下地)の表面に直接メッキが施され溝9a内における成長が促されて、溝9aの深さと略同じ厚みのリード3を生成する。

【0053】上記メッキ金属としては適度な硬さと弾性を持つもの、例えばニッケル又はニッケル合金であり、メッキ成長下地たる導電層3″を銅又は銅合金で形成することにより上記ニッケル又はニッケル合金とは極めて50 強固に結合する。

7

【0054】次に図16A、Bに示すように図15の感光性樹脂層9を除去すると、導電層3″及び剥離層8″の表面に横断して上記メッキ成長により形成されたリード3が等間隔をおいて並列されたベース板が得られる。

【0055】次に、図16におけるベタに成膜された導電層3″をメッキ成長により形成された各リード3間において除去(例えばエッチングにて除去)し、図17A、Bに示すように各リード3の下地として細長導電層3′を残存する。

【0056】との結果、第1ベース板2Aの表面には並 10 列配置された細長導電層3′が形成され、この細長導電層3′の表面にメッキ成長によって形成されたリード3 の結合片3bが固着されると共に、第2ベース板2Bの表面には並列配置された細長剥離層8が形成され、この細長剥離層8の表面にメッキ成長によって形成されたリード3の弾性接片3aが形成されている。

【0057】然る後、第2ベース板Bをリード3から剥離し除去することにより、図7A、Bに示したと同様のプローブユニットが形成される。

【0058】即ち、リード3はその結合片3bによって 20 第1ベース板2Aの表面に強固に結合し、第2ベース板2B上に延在していたリード部分は第1ベース板2Aの一端から側方へ遊離し突出したプローブユニットが形成される。このリード突出部で前記弾性接片3aを形成する。

【0059】上記第2ベース板2Bを除去するに際してのリード3からの剥離を容易にするために、第2ベース板Bの表面に剥離層8′を形成したものである。

【0060】上記第2ベース板2Bは剥離層8′とリード3の界面から界離しつつ除去され、従って剥離層8′はこの第2ベース板2Bに付着した状態で除去される。

【0061】従って、図9A、Bに示すように、リード3はベース板2との結合片3bにおいてメッキ成長下地たる細長導電層3′を介して上記ベース板2Aに固定され、このベース板2Aから突出する弾性接片3aの裏面には剥離層8′が残置しない構造となる。

【0062】との時剥離層8′を弾性接片3aの下面に 残置させたままにすることができる。

【0063】図9に示すと同様、上記リード3は上記導電層3′の一端延在部の表面においてメッキ成長させ、他端延在部をベース板2Aの表面に露出させてIC等との接続に供する電極端子を形成する。

【0064】換言するとメッキ成長にて形成されたリード3は導電層3′の一端延在部の表面に結合片3bにより結合され、且つこの導電層3′の一端延在部を介してベース板2Aに結合された構造となり、このリード結合片3bの後端から後方へ細長導電層3′の他端延在部が導出され露出されて電極端子を形成する。

【 0 0 6 5 】又は図 1 6 B 等から理解できるように細長 【図 1 0 】との発明 導電層 3 ′の全長に亘ってメッキ成長によるリード 3 を 50 ス板断面図である。

形成し、このリード3の結合片3b端部にて上記電極端 子3b′を形成する。

【0066】図1は上記プローブユニットによって形成された検査ユニットを示し、プローブユニット1はベース板2を以って担体4の斜面に接着し、リード3の一端突出部(弾性接片3a)を前下り状態にして液晶パネル5の電極層5aに弾力的に加圧接触させる。他方上記担体4斜面にIC6と回路基板7を設置し、上記ベース板2の表面に接着されたリード他端(結合片)3bをIC6を介して回路基板7に接続する。

[0067]

【発明の効果】以上のように、この発明によればエッチング法等により形成したリード群を接着剤によりベース 板表面に接着する場合のような、接着剤の収縮によるビッチ変化等の問題を有効に防止できる。

【0068】又接着剤塗布や接着作業の困難性、或いは 接着するまでの整列を保持するタイバー等のリード間連 結手段を要せず、このタイバーを爾後的に切断する困難 な作業も排除できる。

20 【0069】又メッキ成長によりリード群を極小ビッチ に高精度に形成でき、弾性接片の弾性付与に必要な厚み も充分に確保できる。

【0070】又弾性接片はメッキ成長時ベース板によって適正に支持され適正にピッチが保たれ、ベース板の一部を除去するか、第2ベース板を除去することによって弾性接片を遊離し突出させた状態を容易に形成できる。 又第2ベース板は第1ベース板からの除去及び弾性接片からの剥離が容易に行なえ、ベース板の一部を切除して弾性接片から剥離する場合の困難性を排除できる。

| 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明によるプローブユニットによって検査 ユニットを形成した例を示す断面図である。

【図2】A図は上記プローブユニットを形成する方法の 第1実施例を示すベース板断面図、B図は同斜視図であ り、A図はB図におけるA-A線断面図を示す。

【図3】図2の次の工程を示すベース板断面図である。

【図4】A図は図3の次の工程を示すベース板断面図、 B図はマスク斜視図である。

【図5】A図は図4の次の工程を示すベース板断面図、 40 B図は同斜視図であり、A図はB図におけるB-B線断面図である。

【図6】図5の次の工程を示すベース板断面図である。

【図7】A図は図6の次の工程を示すベース板断面図、 B図は同斜視図であり、A図はB図におけるC-C線断 面図である。

【図8】図7の次の工程を示すベース板断面図である。

【図9】A図は図8によって形成されたプローブユニットの断面図、B図は同斜視図である。

【図10】との発明の第2実施例の原理思想を示すべー ス板断面図である。

8

(6)

特開平8-15318.

【図11】A図は上記第2実施例の具体例を示すB図に

おけるベース板のD-D線断面図、B図は同斜視図であ

【図12】図11の次の工程を示すベース板断面図であ

【図13】A図は図12の次の工程を示すベース板断面

【図14】A図は図13の次の工程を示すB図における

【図15】図14の次の工程を示すベース板断面図であ 10

ベース板のE-E線断面図、B図は同斜視図である。

る。

る。

図、B図は同斜視図である。

10 *ベース板のG-G線断面図、B図は同斜視図である。 【符号の説明】

1 プローブユニット

2 ベース板

2A 第1ベース板

2 B 第2ベース板

3 メッキ成長リード

3′ 細長導電層

3" ベタの導電層

3 a 弾性接片

3 b 結合片

8 細長剥離層

8′ ベタの剥離層

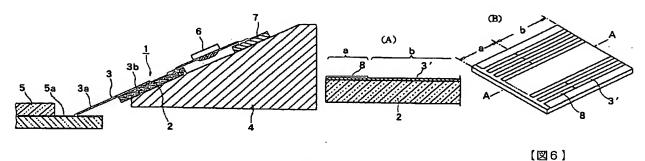
【図16】A図は図15の次の工程を示すB図におけるベース板のF-F線断面図、B図は同斜視図である。

【図17】A図は図16の次の工程を示すB図における*

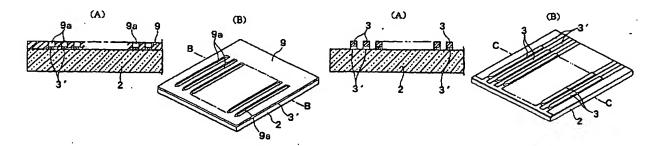
【図1】

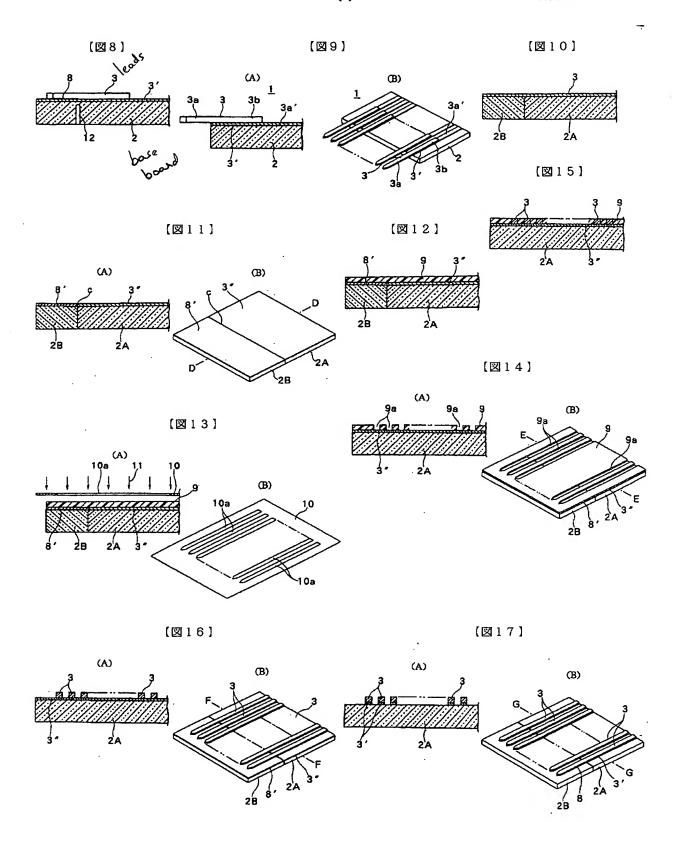
【図2】

【図7]



【図5】





フロントページの続き

(72)発明者 奥野 敏雄

福岡県福岡市博多区半道橋1丁目6番46号 九州日東精工株式会社内

(72)発明者 人見 保幸

京都府綾部市井倉新町瓜田8番地の1 日

東公進株式会社内